2ЦЗЧЦЧЦЪ ₽РГРЦЧЦЪ ЦГОЦЧРГ АРМЯНСКИЯ ХИМИЧЕСКИЯ ЖУРНАЛ

XXX, № 11, 1977

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

УДК 541.183.23

ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СПЕКАНИЯ НАТРИЕВОГО ЕРЕВАНИТА-10

М. Г. МАНВЕЛЯН и К. Б. ОГАНЕСЯН

Институт общей и неорганической химин АН Армянской ССР, Ереван

Поступило 8 VI 1977

Проведено электронно-микроскопическое исследование процесса спекания натриевого ереванита-10—продукта комплексной переработки нефелинового сиенита. Показано, что спекание ереванита-10 проходит по механизму, общему для корпускулярных систем, но значительно быстрее и при более низких температурах, чем обычно чистый кремнезем. Интенсивное объемное спекание и стеклование ереванита-10 начинается при $t > 700^\circ$; при этой же температуре наблюдается образование кристаллического SiO₂.

Рис. З, табл. 1, библ. ссылок 18.

Термическая обработка ксерогелей, в частности силикагелей, предварительно пропитанных солями щелочных и щелочноземельных элементов [1, 2]—один из эффективных способов получения адсорбентов и носителей с малой поверхностью и широкими порами. В этом отношении определенный интерес представляет новый силикатный материал—натриевый ереванит-10, получаемый при комплексной переработке нефелинового сиенита [3]. Химический состав ереванита-10 в пересчете на сухое вещество (вес %): SiO₂—90, Na₂CO₃—10, примеси—10⁻¹⁰ Сода частично находится в хемосорбированном состоянии — _SI-ONa [4].

Распределение соды в ереваните-10 более однородно, чем в случае самого тщательного перемешивания (или пропитки) кремнезема с содой. В ереваните-10 сода покрывает поверхность глобул кремнезема тонкой оболочкой [4].

Термическая обработка тонжодноперсного порошка ереванита-10 опытнозаводского производства проводилась р интервале 200÷1300' в течение 4 час. Структура полученных образцов исследовалась методами адсорбции (расчет величин удельной поверхности по БЭТ, из изотерм адсорбции криптона [5]), электронной микроскопии [6] и ИК спектроокопии [7].

Основные результаты исследования приведены в таблице.

Таблица

Влияние термической обработки на структурные характеристяки натриевого ереванита-10

Темпера- тура, °С	Величина удельной поверхно- сти, м ² /г	Наблюдаемая структура по данным	
		электронной микроскопии	ИК спектро- скопии
- 19	исходный 17,6	глобулярная (<i>D</i> в. м. 50—100 Å), содовый покров	аморфный, Na ₂ CO ₃
- 400	8,5	агрегированная корпускулярная (D _{9. м.} 600 Å)	
600	7,6		аморфный, StO ₂
700	6,2	губчатая, широкопористая	
800	2,2	грубодисперсная, рыхлоупакованная	
900	1,4	рельефная, расплывшаяся масса	
1000	0,56	плотная масса, игольчатые кристаллы	кристобалит
1300	0,27	плотная масса, гексагональные и иголь- чатые кристаллы	1.05

Как видно из таблицы, уже при 400° поверхность ереванита-10 сокращается в 2 раза. Следующее, более резкое сокращение S происходит при 800° ($S=2,2 \ m^2/z$), а при $t \ge 1000°$ поверхность ереванита-10 почти полностью спекается.



Рис. 1. Кривая зависимости S от t прогрева натриевого ереванита-10.

Приведенная на рис. 1 кривая зависимости S от t прогрева ереванита-10 несколько отличается от соответствующих кривых, полученных для чистого кремнезема, для которых характерно линейное падение S с ростом t [18]. Здесь же в интервале 400—700° наблюдается почти горизонтальный ход кривой, указывающий на термостабильность поверхности. Лишь при t > 800° воостанавливается характерный для SiO₂ вид кривой.

883

На рис. 2 приведены электронно-микроскопические снимки образдов 1—8.



Рис. 2. Эдектронно-микроскопические снимки угольных реплик с поверхности частиц порошка исходного ереванита-10 (а) и образцов, прогретых при: 6-400, в-700, г-800, д-900, е-1000, ж, з. и-1300°.

Исходный ереванит-10 имеет мелкоглобульное строение скелета (рис. 2а), размер глобул 50—100 Å (просматривается сквозь пленку содовую оболочку [4]). Пропрев при 400° приводит к значительному уплотнению структуры, деформации и «срастанию» глобул в цепочки и агрегаты (рис. 2 б). Пленка, заметная на рис. 2 а, здесь отсутствует.

Исследование спекания натриевого ереванита-10

Примерно такая же картина, но с большим числом агрегированных образований, наблюдалась при просмотре образца З. Термическая обработка при 700° приводит к образованию широкопористой структуры (поры-светлые участки между «сросшимися» агрегатами D_{э.м.}~1000-1500 А). При 800° образуется рыхлоупакованная грубодисперсная структура, состоящая из плотных слоистых атрегатов размером 15-40 ммк (такого же лорядка зазоры-пустоты между ними, рис. 2 г). В ереваните-10, прогретом при 900° (рис. 2 д), наряду с грубодисперсной структурой видны микрообласти расплывшейся рельефной массы, напоминающей тубчатые стекла. При 1000° глобулярный скелет ереванита-10 спекается в стеклообразную массу, на поверхности которой (в утлублениях) наблюдаются игольчатые кристаллы (l=1000-1500 А), число которых с дальнейшим ростом температуры увеличивается, и на микрофотографии образца 8 (1300°) уже видны упакованные в пачки игольчатые и большое количество очень мелких плоских кристаллов (в левом верхнем углу рис. 2ж). На рис. 23 приведены отдельные микрообласти поверхности скола образца 8, снятые при большем электронно-оптическом увеличении (видны длинные кристаллы и кристаллы гексагональной формы). Визуально наблюдается спекание тонкодиоперсного порошка ереванита-10 в крупку (при 700-900°), а затем при дальнейшем повышении t-в прозрачную стеклообразную массу.



Рис. 3. ИК спектры исходного натриевого среванита-10 (а) и образцов;. прогретых при: 6-600, в - 700, г - 1300°.

Согласно данным ИК спектроскопии, уже при 700° в среваните-10⁴ наблюдается образование кристаллической SiO₂—кристобалита (рис. 3, кр. г. полосы 795, 623 см⁻¹, характерные для валентных в деформационных колебаний Si—O—Si связи кремнекислородных тетраэдров в

885

М. Г. Манвелян, К. Б. Оганесян

решетке кристобалита [7]*). ИК спектры исходного и прогретных до 600° образцов ереванита-10 в целом идентичны (рпс. 3, кр. а, в) п соответствуют спектру аморфной SiO₂ (валентные колебания Si—O— Si связи при 800 cm^{-1} [7]). В спектре образца 3, по сравнению с исходным ереванитом-10, отсутствуют лишь слабовыраженное плечо при 885 cm^{-1} и полоса 1450 cm^{-1} (валентные и деформационные колебания C=O связи [9]). Интенсивность этих полос постепенно уменьшается с ростом і прогрева. Против ожидания, ИК спектр образца 8 (рис. 3, кр. г) показал, что при 1300° в ереваните-10 образуется только кристобалит, в то время как на микрофотографиях (рис. 2 ж, и) видны кристаллы различной формы.

Длинные итольчатые кристаллы кристобалита были получены и в [10, 11]. Что касается кристаллов гексагональной формы, то их можно отнести к кварцу или тридимиту, скорее всего к тридимиту, т. к. известно, что присутствие Na⁺ в кремнеземе способствует образованию именно тридимита. Отсутствие характеристических полос тридимита (или кварца) в ИК спектре образцов, по-видимому, связано с неоднородностью распределения кристаллов, их небольшими размерами и, возможно, меньшим содержанием по сравнению с кристаллами игольчатой формы. Можно надеяться, что применение других более чувствительных методов исследования, даст возможность точно идентифицировать эти кристаллические образования. Образование кристаллической SiO₂ отмечалось и на рентгенограммах.

Полученные результаты показывают, что спекание ереванита-10 проходит по механизму, общему для корпускулярных систем [11—13] с характерным двухэталным спеканием. Первый этап—низкотемпературное поверхностное «срастание» элементов структуры (в данном случае глобул)—результат диффузии вакантных мест из объема глобулы к поверхности и прежде всего к поверхности их контакта [13]); второй—высокотемпературное объемное сплавление глобул как следствие перехода из твердого в вязкотекучее состояние [12].

Именно таког поверхностное «срастание» глобул, вызывающее сокращение поверхности ереванита-10 в 2 раза, наблюдается на рис. 2 б. С повышением температуры прогрева «срастание» глобул н их агрегация увеличиваются, поэтому следовало ожидать еще большего сокращения S. Однако, как уже отмечалось, повышение t до 400—700° не вызывает заметного уменьшения S (по сравнению с предыдущими образцами).

Тонкодисперсное распределение Na₂CO₃, очевидно, способствует твердофазному взаимодействию с SiO₂ уже при относительно невысоких температурах. Интенсивность полос деформационных и валентных

^{*} Такие же спекрты были получены для образцов 5—7; с повышением температуры прогрева интенсивность полос возрастает. В ряде случаев наблюдались слабые полосы при 500—600 см⁻¹, не относящиеся к кристобалиту.

колебаний C=0 связи в ИК спектре ереванита-10 постеленно, по мере повышения температуры прогрева, уменьшается и при 700° эти полосы отсутствуют. Выделение CO_2 уже при 300—350° из ереванитов-25 и 10 отмечалось и в [14], в которой было проведено сравнительное исследование спекания натриевых ереванитов и смеси кварцевого леска с содой. Было показано, что стеклообразование в ереванитах происходит при t на 100—200° ниже, чем в соответствующих смесях леска с содой.

Очевидно, термическая обработка ереванита-10 сопровождается постепенной «заменой» содовой оболочки на поверхностное силикатное соединение типа Na₂O·nSiO₂ [15] (где n=1-3, с ростом *t* прогрева и более глубоким продвижением Na⁺ в объем глобулы SiO₂ $n\rightarrow3$). Энергичный ход твердофазной реакции между аморфной SiO₂ и Na₂CO₃ в ереванитах при 400—700° стмечался и в [14]. Поверхности чистой соды и, например Na₂SiO₃, равны 0,44 и 3,5 m^2/z , соответственно. Естественно, что образование силиката натрия—своего рода «очищение» поверхности глобул аморфной SiO₂ от Na₂CO₃, должно вызывать увеличение *S*. Очевидно, сокращение поверхности ереванита-10 при 400—700° («срастание» и агрегирование глобул) компенсируется приростом *S* за счет «очистки» поверхности от содовой оболочки (см. ИК спектры). Такое же явление наблюдалось в [16] при термической обработке метасиликата кальция, содержащего CaCO₃.

Второй этал спекания—объемное слияние глобул (частичное или полное), происходит уже при $t \gg 700^{\circ}$ (в случае чистого кремнезема при $t \gg 1000^{\circ}$ [11]). Внедрение катиона в полимерную структуру кремнезема (расщепление Si-O-Si связей [17, 18]) способствует более быстрому переходу твердого вещества в вязкотекучее состояние. Объемное спекание ереванита-10 сопровождается почти полным спеканием поверхности. В вязкотекучем состоянии становится возможной ориентированная перестройка кремнекислородных тетраэдров—образование и рост кристаллической SiO₂ (вначале в поверхностном, а затем и объемном расплаве). Образование кристобалита, по-видимому, связано с тем, что внедрение Na⁺ в полимерную структуру SiO₂ изменяет длину связи Si-O, приближая ее к кристобалиту [17].

ՆԱՏՐԻՈՒՄ–ԵՐԵՎԱՆԻՏ–10–Ի ԵՌԱԿԱԼՄԱՆ ՊՐՈՑԵՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ–ՄԻԿՐՈՍԿՈՊԻԿ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մ. Գ. ՄԱՆՎԵԼՑԱՆ L Կ. Բ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՑԱՆ

էլեկտրոնային-միկրոսկոպիկ, ԻԿ սպեկտրոսկոպիկ և ադսորբցիոն մե-Բոդներով ուսումնասիրված է նեֆելինային սիենիտների կոմպլեքսային վերամշակումից ստացված նոր սիլիկատային նյունի՝ նատրիում-երևանիտ-10-ի եռակալման պրոցեսը։ Ցույց է տրված, որ 200—1300° սահմաններում թերմիկ մշակումը երևանիտ-10-ի մակերեսը 17,6 մ²/գ-ից փոքրանում է մինչև 0,27 12/q:

Երևանիտ-10-ի եռակալումը ընթանում է կորպուսկուլյար կառուցվածըների ընդհանուր սիսեմայով, թայց ավելի ինտենսիվ։

Երևանիտ-10-ի գլորուլային կառուցվածքի ծավալային եռակալումը սկսվում է 700°-ում և ուղեկցվում է լայնածակոտկեն կառուցվածքի գոյաgnulni, nph S=6,2 J2/q: Այդ նույն ջերմաստիճանում նկատվում է ամորֆ SiO2-ի անցումը բյուրեղայինի։

ELECTRON-MICROSCOPIC INVESTIGATION OF THE CAKING PROCESS OF SODIUM EREVANITE-10

M. O. MANVELIAN and K. B. HOVHANNISSIAN

The caking process of the new silicate, material sodium erevanite-10 obtained from a complex treatment of the napheline syenites has been investigated by methods of electronic microscopy, infrared spectroscopy and adsorption. It was shown that thermal treatment at an interval of 200-1300 °C led to a surface reduction of erevanite-10 from 17,6 to 0,27 m^{*}/g depending on the temperature of treatment. The caking process of erevanite-10 proceeded in a manner similar to corpuscular structures but was more intensive. The volume caking of the globular structure of erevanite-10 began at 700°C and led to the formation of a wide-porous structure with $S = 6.2 m^2/g$.

Amorphous SIO, was transformed into the crystalline state at the same temperature.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Н. К. Бебрис, А. И. Брук, Д. А. Вяхирев, А. В. Киселев, Ю. С. Никитин, Колл. ж., 84, 491 (1972).
- 2. А. В. Киселев, Я. И. Яшин, Газо-адсорбционная хроматография, Изд. «Наука». M., 1967.
- 3. М. Г. Манвелян, Сб. Химия и технология глинозема, Тр. Всесоюзи. совещ., Ереван, 1964, стр. 427.
- 4. М. Г. Манвелян, Э. Б. Оганесян, К. Б. Оганесян, М. С. Гаспарян, Ары. хям. ж., 27, 458 (1974).
- 5. Экспериментальные методы в адсорбани и молекулярной хроматографии, Изд. МГУ, М., 1973, стр. 108, 198.
- 6. М. Г. Манвелян, Э. Б. Осанесян, К. Б. Оганесян, М. С. Гаспарян, Арм. хнм. ж. 26, 377 (1973). 7. H. Moenke, Mineralspektren, Bd. 1, Bd. II, 1962, 1964, Akademie-Verlag, Berlin.
- 8. Г. К. Красильников, В. Ф. Киселев, Н. В. Капитонова, Е. А. Сысоева, ЖФХ. 31, 1448 (1957).
- 9. А. И. Лазарев, Колебательные спектры в строение скликатов, Изд. «Наука», Л., 1968, стр. 136.
- 10. O. M. Florke, Z. Kristallogr., 118, 470 (1963).

-888

- 11. А. В. Киселев, Ю. С. Никитин, Э. Б. Оганесян, Колл. ж., 29, 95, (1967); 30, 232 (1968).
- 12. Я. И. Френкель, Ж. эксп. и техн. физики, 16, 29 (1948).
- 13. В. Я. Пинес, Усп. физ. наук, вып. 4, 501 (1954).
- 14. М. Г. Манвелян, К. А. Костанян, А. А. Маркарян, Изв. АН Ары.ССР, № 3, 291 (1963).
- 15. М. А. Матвеев, А. Н. Рабухин, ЖВХО, 8, 205 (1963).
- 16. Э. Б. Оганесян, К. Б. Оганесян, К. В. Цаканян, Ж. В. Габриелян, Арм. кем. ж., 30, 150 (1977).
- 17. I. I. Friplat, A. Leonard, N. Barake, Bull. soc. chim. France, Na 1, 122 (1962).
- .18. T. L. Davis, J. P. Mirth, J. Appl. Phys., 37, 2112 (1966).